読者の広場

日本分光学会秋季講演会・日本光学会年次学術講演会
Optics & Photonics Japan 2006報告

平成18年11月8日～10日、学術総合センター（千代田区一ツ橋）において日本分光学会と日本光学会の共催による Optics & Photonics Japan 2006（以下 OPJ 2006と記載）が開催された。

従来、日本分光学会では毎年秋に秋季講演会を実施していたが、昨年秋に日本光学会より OPJ 2006の共催の要請があったため並せて受諾し、本年度は秋季講演会をOPJ 2006に組み入れる形として実施した。

日本分光学会では、日本光学会・日本分光学会合同シンポジウム「分光学と光学の融合と協調」、「分光」一般講演セッションおよび極端紫外分光部会合同企画シンポジウム「EUV リソグラフィ技術の進展」の3つのプログラムと実施を担当した。

本稿では、主にこれらの分光学会企画について報告する。

・日本光学会・日本分光学会合同シンポジウム
「分光学と光学の融合と協調」
11月8日（水） 9：50～16：10

シンポジウムの最初に本学会の河田聡会長（大阪、理研）が「ナノ光学からナノ分光学への展開」と題した45分間の日本分光学会会長特別講演を行った。講演では光学と分光学の相違や将来の融合について明快な議論が行われたあと、ナノフォトニクスの最新動向などが紹介された。引き続き、表題通り光学と分光学を融合して研究を行っている若手研究者を中心に、13件の招待講演が行われた。

本シンポジウムは一時的に立ち見が出るほどの盛況で、参加者は約80名であった。なお、本シンポジウムは井上康志先生（大阪）が企画し、井上先生、石橋孝章先生（広大）、橋本守先生（大阪）が座長を担当した。

・「分光」一般講演セッション
11月8日（水） 16：10～17：30

上記シンポジウムに続いて、4件の一般講演が橋本守先生を座長として行われ、活発な討論が行われた。

・日本分光学会極端紫外分光部会合同シンポジウム
「EUV リソグラフィ技術の進展」
11月9日（木） 9：55～15：00

波長13.5 nm のプラズマ発光を用いた EUV リソグラフィは、波長193 nm の ArF エキシマレーザーに続く、次世代の半導体リソグラフィ技術として注目を集めている。OPJ 2006の共催にあたり、日本光学会から合同企画のテーマ案として「EUV リソグラフィ」が提案され、極端紫外分光部会が担当し、本シンポジウムを開催した。日本の EUV リソグラフィ開発をリードする8名の技術者および研究者によって、光源から結像光学系、レジストまで、その開発動向が講演された。座長は河村徹先生（東工大）および東京武史先生（宇宙宮大）が担当し、参加者は約60名であった。

OPJ 2006全体の参加者数の速報値は以下の通り。

一般会員：374
一般非会員：116
学生会員：118
学生非会員：93
シンポジウム講演者：107
招待講演者：43
合計：851

ところで、日本分光学会では毎年春と秋に学術講演会を行ってきたが、現在9つある部会活動の活発化などに伴って、来年以降は分光学会全体として行う講演会は年に一度、秋季のみを行う事とした。なお、来年の年次講演会は、平成19年11月12日（月）～14日（水）、東京工業大学百年記念館（東京都目黒区大岡山2-12-1）で開催予定である。

（東京工業大学・沖野晃俊、OPJ 2006実行副委員長、極端紫外分光部会幹事）